

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年12月6日(2012.12.6)

【公開番号】特開2011-91096(P2011-91096A)

【公開日】平成23年5月6日(2011.5.6)

【年通号数】公開・登録公報2011-018

【出願番号】特願2009-241538(P2009-241538)

【国際特許分類】

H 01 L 21/3065 (2006.01)

H 01 L 21/31 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/302 101D

H 01 L 21/302 101G

H 01 L 21/31 C

【手続補正書】

【提出日】平成24年10月19日(2012.10.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

本発明に係る試料台は、基板処理が施されるべき被処理基板を保持する試料台において、被処理基板が面接触する接触面を有し、該接触面に面接触した被処理基板を吸着する吸着板と、該吸着板の非接触面が接着された凹面を有する支持基板とを備え、前記凹面の略中央部の深さと、該中央部から離隔した離隔部位の深さとの差は、該中央部に接触する部位における前記吸着板の厚みと、前記離隔部位に接触する部位における前記吸着板の厚みとの差よりも大きく、更に、前記支持基板は、アルミニウム部材からなり、被処理基板を冷却するための冷却水が通流する冷却水流路を備え、前記吸着板は、前記接触面にラッピング加工が施されたセラミック部材からなり、被処理基板を加熱するためのヒータと、被処理基板を静電吸着するための電極とを該セラミック部材の内部に備えることを特徴とする。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正7】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板処理が施されるべき被処理基板を保持する試料台において、

被処理基板が面接触する接触面を有し、該接触面に面接触した被処理基板を吸着する吸着板と、

該吸着板の非接触面が接着された凹面を有する支持基板と
を備え、

前記凹面の略中央部の深さと、該中央部から離隔した離隔部位の深さとの差は、該中央部に接触する部位における前記吸着板の厚みと、前記離隔部位に接触する部位における前記吸着板の厚みとの差よりも大きく、

更に、前記支持基板は、

アルミニウム部材からなり、被処理基板を冷却するための冷却水が通流する冷却水流路を備え、

前記吸着板は、

前記接触面にラッピング加工が施されたセラミック部材からなり、被処理基板を加熱するためのヒータと、被処理基板を静電吸着するための電極とを該セラミック部材の内部に備える

ことを特徴とする試料台。

【請求項2】

請求項1に記載の試料台を備え、マイクロ波によって処理室内にプラズマを生成し、該プラズマにて被処理基板にプラズマ処理を施すように構成してある

ことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理装置。